発光分光計測による大気圧非平衡 Ar プラズマの電子温度・電子密度の導出と比較

Derivation and Comparison of Electron Temperature and Density of Atmospheric-

pressure Non-equilibrium Ar Plasma by Optical Emission Spectroscopy

東工大¹,東工大技術部²,東工大研究院³ ^O(M2)大西 広¹,根津 篤²,赤塚 洋³

Tokyo Tech¹, Tech Dept.², IIR, Tokyo Tech³, °Hiroshi Onishi¹, Atsushi Nezu², Hiroshi Akatsuka³ E-mail: onishi.h.ab@m.titech.ac.jp

1. はじめに

大気圧プラズマは、現在幅広く応用されている。 例えば、材料の表面処理や野菜の成長促進、外傷 に対する血液の凝固などが挙げられる。幅広く応 用されている一方で、これらの現象を理解する上 で重要なパラメータである電子温度(*T*_e)と電子密 度(*N*_e)の計測に関して、報告例が少ない。そこで 本研究では発光分光計測(OES)によって、様々な 解析方法で大気圧非平衡 Ar プラズマの電子温 度・電子密度を導出しその比較を試みる。

2. 実験装置

本実験において、Fig.1 に示す放電装置(エコデ ザイン株式会社製)を使用した。装置は電極とそ れを覆うガラス管に加え、さらに外側のアルゴン 流路となるガラス管、ネオントランス用いた高電 圧電源、光ファイバー導入管、およびそれらを支 える支持板により構成される。両電極には、二次 電圧値で最大 9 kV_{PP} 程度の電圧が印加される。 両電極を覆うガラス管内は水で満たされており、 1 mmのギャップを設け、ストリーマ状の誘電体 バリア放電として、放電プラズマが生じる構造で ある。



Fig.1 Schematic Experimental Device

3. 解析手法

今回4つの解析手法を用いて解析を行った。1つ 目は、得られた線スペクトルに対してボルツマン プロットを行い、励起温度を求める。そして励起 状態生成消滅を正しく記述する衝突輻射モデル (CR モデル)にて、励起温度と電子温度の関係性 を求めて、電子温度を求める、線スペクトル解析 である^[1]。2つ目は、電子-原子制動輻射がプラズ マ中で支配的であると仮定して、理論計算値と感 度校正した実験結果をフィッティングすることによって電子温度と電子密度を求める、連続スペクトル解析である^[2]。3つ目が水素のバルマー系列の H_a線をもとに電子密度を求める、シュタルク拡がり解析である^[3]。そして4つ目は、励起状態数密度を実験値とCRモデルの計算値から求めて比較する励起状態数密度解析である^[4]。今回、励起状態数密度解析のCRモデル計算の入力データには、連続スペクトル解析の結果を用いた。またCRモデルの計算や連続スペクトルの解析において、電子エネルギー分布関数(EEDF)が重要になるが、今回は Maxwellian と Druyvesteynian EEDF の2つを用いた。

4. 結果

結果を Table1 に示す。参考文献[5]と比較する と、解析結果(1),(5)および(7)が参考文献[5]に近い 値を示した。また(9)の励起状態数密度解析の結 果については、CR モデルの計算値および実験値 ともに、似た傾向を示した。

Number	Method	EEDF	<i>T</i> _e [eV]	$N_{\rm e} [{\rm cm}^{-3}]$
(1)	Line Spectrum with CR model	Maxwell	0.73	1.0×10 ¹⁰ ~1.0×10 ¹⁴
(2)			0.44	1.0×10 ¹⁵ ~1.0×10 ¹⁶
(3)		Druyvesteyn	2.70	1.0×10 ¹⁰ ~1.0×10 ¹¹
(4)			1.03	1.0×10 ¹²
(5)			0.61	1.0×10 ¹³ ~1×10 ¹⁶
(6)	Continuum Spectrum	Maxwell	0.29	1.1×10 ¹⁶
(7)		Druyvesteyn	0.79	1.4×10 ¹⁴
(8)	Stark Broadening		\square	7.2×10 ¹⁵
(9)	Comparison of N_p	Maxwell Druyvesteyn	The tendency of each analysis result is similar.	
(10)	Reference [5]		0.86~8.60	1.0×10 ¹³

Table1 Analysis Results

参考文献

[1]赤塚洋, 応用物理, 87, 821(2018).

[2] S. Park, W. Choe, H. Kim and J. Y. Park, Plasma Sources Sci. Technol., **24**, 034003 (2015).

[3] A. Y. Nikiforov, C. Leys, M. A. Gonzalez and J. L. Walsh, Plasma Sources Sci. Technol., **24**, 034001 (2015).

[4] Y. Yamashita, F. Yamazaki, A. Nezu and H. Akatsuka, JJAP, **58**, 016004 (2019).

[5] C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison and P. Leprince, Spectrochimica Acta Part B **61**, 2 (2006).